

RÉACTEUR DE GRAVURE DE PLASMA

FICHE N° 1734

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Inconnu

Domaines : Matériaux

Sous-domaines : Composants électroniques

Organisme : Université de Nantes - UFR Sciences et techniques

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description

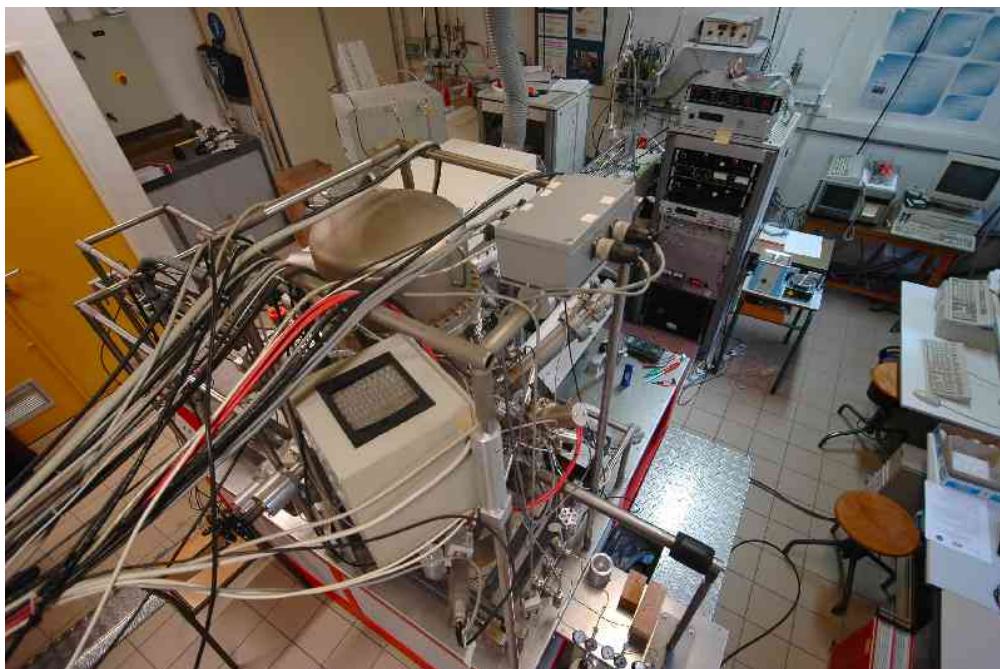
Le traitement des matériaux par la technique du plasma froid nécessite un appareillage imposant et complexe. Il se compose des éléments suivants: une installation à vide, une injection d'énergie, une admission de gaz et un automate qui pilote l'opération. Le plasma est le gaz injecté, celui-ci possède des propriétés très particulières: il est ionisé, conducteur et émet un rayonnement électromagnétique. Le procédé de plasma froid permet d'atteindre toute la surface du substrat et de le couvrir d'une couche mince, de l'ordre du nanomètre. Par ce traitement, les matériaux (puces, élastomères, verre) acquièrent de nouvelles propriétés performantes.

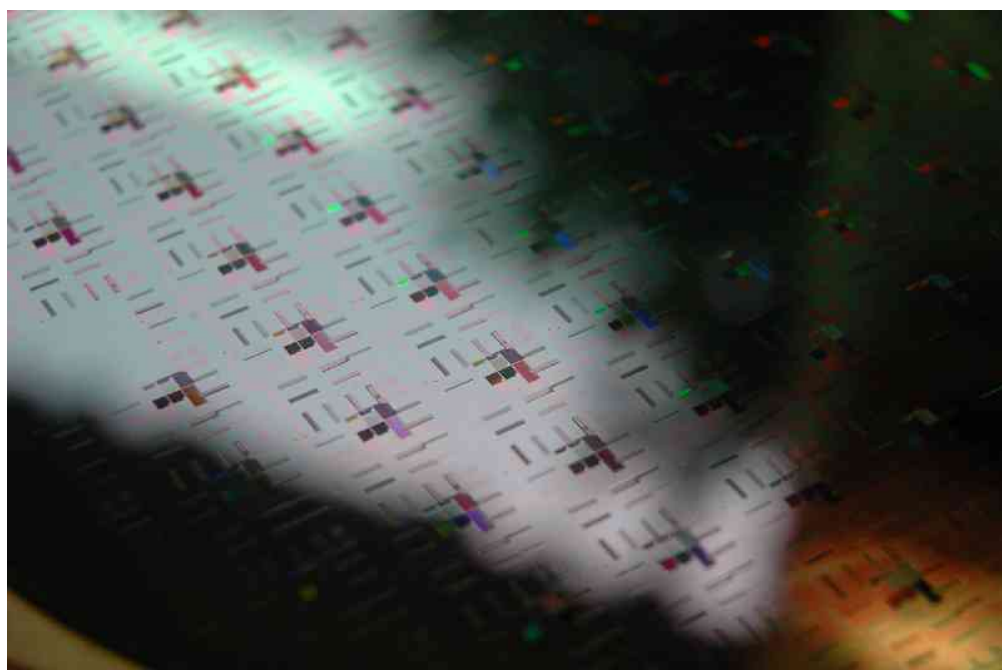
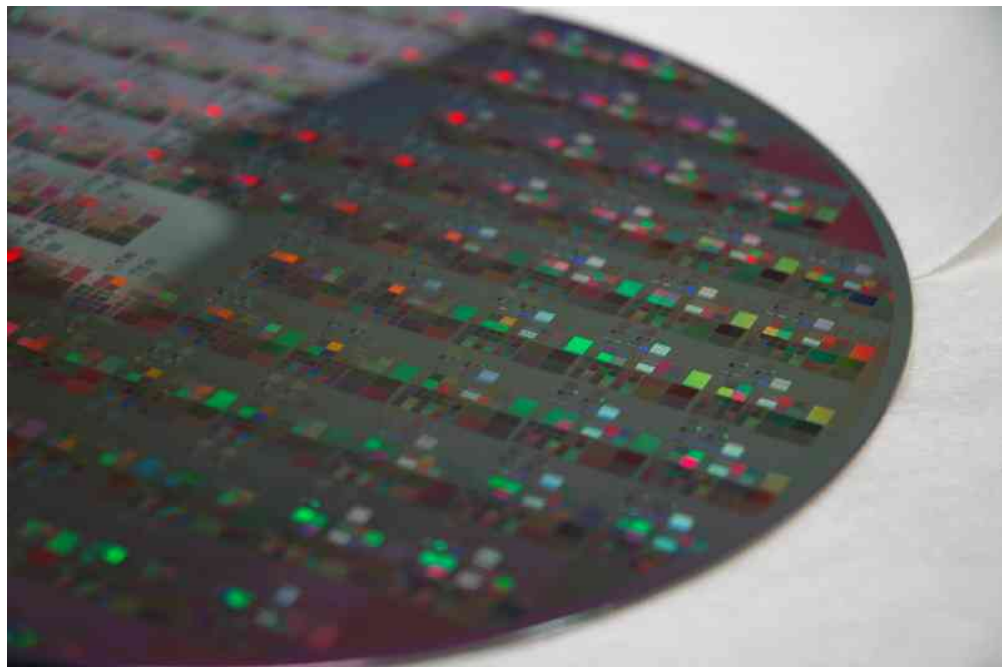
Le dispositif est complété par des équipements d'analyse du procédé.

Utilisation

Cette technologie permet une grande diversité de traitements de surface: amélioration de l'adhésivité, de la mouillabilité ou la conductivité. elle trouve des applications dans les industries de télécommunications.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Réacteur de gravure de plasma (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1664>, consulté le 2026-07-22